



Gtechnews

文章 8409 | 总阅读 601万

(China)

Toppan Photomask enters into partnership with EV Group – September 20, 2022

Toppan Photomask与EV Group达成合作

2022-09-20 15:26

(全球TMT2022年9月20日讯) 光掩模供应商Toppan Photomask Co. Ltd.与为MEMS、纳米技术和半导体市场提供晶圆键合及光刻设备的供应商EV Group (简称EVG) 宣布, 两家公司已达成协议, 共同推广赋能光电产业的大批量制造(HVM)工艺——纳米压印光刻技术(NIL)。此次合作旨在确立NIL为光电制造的行业标准生产工艺, 并加速其在HVM中实施, 以支持各种应用。这些应用包括增强/混合/虚拟现实耳机、智能手机、汽车传感器和医疗成像系统。

(全球TMT2022年9月20日讯) 光掩模供应商Toppan Photomask Co. Ltd.与为MEMS、纳米技术和半导体市场提供晶圆键合及光刻设备的供应商EV Group (简称EVG) 宣布, 两家公司已达成协议, 共同推广赋能光电产业的大批量制造(HVM)工艺——纳米压印光刻技术(NIL)。此次合作旨在确立NIL为光电制造的行业标准生产工艺, 并加速其在HVM中实施, 以支持各种应用。这些应用包括增强/混合/虚拟现实耳机、智能手机、汽车传感器和医疗成像系统。



EV Group和Toppan Photomask

作为此次非排他性合作的一部分, EVG和Toppan Photomask将结合各自的知识、专长和服务, 利用Toppan Photomask提供的主模板和EVG提供的设备及工艺开发服务, 提供NIL开发工具包, 以进一步推广NIL技术并提高将该技术应用于工业生产的可能性。EVG还将在其位于奥地利总部的EVG NILPhotonics®能

力中心，面向感兴趣的公司提供NIL技术和产品演示。此外，对于有意在生产过程中使用NIL技术的企业，两家公司都将对方指定为首选推荐的供应链合作伙伴。 [返回搜狐](#)， [查看更多](#)

声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。

发布于：上海市

https://www.sohu.com/a/586581626_120188377